

資料12 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む）及び土壌の汚染に係る環境基準

ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準（以下「環境基準」という。）は、次のとおりとする。

第1 環境基準

- 1 環境基準は、別表の媒体の項に掲げる媒体ごとに、同表の基準値の項に掲げるとおりとする。
- 2 1の環境基準の達成状況を調査するため測定を行う場合には、別表の媒体の項に掲げる媒体ごとに、ダイオキシン類による汚染又は汚濁の状況を的確に把握することができる地点において、同表の測定方法の項に掲げる方法により行うものとする。
- 3 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。
- 4 水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。
- 5 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。
- 6 土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区分されている施設に係る土壌については適用しない。

第2 達成期間等

- 1 環境基準が達成されていない地域又は水域にあつては、可及的速やかに達成されるように努めることとする。
- 2 環境基準が現に達成されている地域若しくは水域又は環境基準が達成された地域若しくは水域にあつては、その維持に努めることとする。
- 3 土壌の汚染に係る環境基準が早期に達成されることが見込まれない場合にあつては、必要な措置を講じ、土壌の汚染に起因する環境影響を防止することとする。

第3 環境基準の見直し

ダイオキシン類に関する科学的な知見が向上した場合、基準値を適宜見直すこととする。

別表

媒体	基準値	測定方法
大気	0.6pg-TEQ/m ³ 以下	ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
水質 (水底の底質を除く。)	1 pg-TEQ/l 以下	日本工業規格 K0312 に定める方法
水底の底質	150pg-TEQ/g 以下	水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
土壌	1000pg-TEQ/g 以下	土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
備考		
1 基準値は、2, 3, 7, 8 - 四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。		
2 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。		
3 土壌にあつては、環境基準が達成されている場合であつて、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ/g 以上の場合には、必要な調査を実施することとする。		

資料13 ダイオキシン類に係る措置規制の状況

根拠法令	ダイオキシン類対策特別措置法																																																																																				
大気排出基準	<p>第8条 (対象) 法に基づく大気基準適用施設 (5種類) (規制対象物質及び基準値)</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">規制対象物質 ダイオキシン類</td> <td colspan="2">基準値 [単位: ng-TEQ/m³N]</td> </tr> <tr> <td colspan="4">特定施設の種類の</td> </tr> <tr> <td>①焼結鈳の製造の用に供する焼結炉</td> <td></td> <td>新設施設</td> <td>既存施設</td> </tr> <tr> <td>②製鋼の用に供する電気炉</td> <td></td> <td>0.5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>③亜鉛の回収の用に供する焙焼炉等</td> <td></td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>④アルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉等</td> <td></td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">⑤廃棄物焼却炉</td> <td rowspan="3">焼却能力</td> <td>4,000kg/時間～</td> <td>0.1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2,000～4,000kg/時間</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>～2,000kg/時間</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> </table>	規制対象物質 ダイオキシン類		基準値 [単位: ng-TEQ/m ³ N]		特定施設の種類の				①焼結鈳の製造の用に供する焼結炉		新設施設	既存施設	②製鋼の用に供する電気炉		0.5	5	③亜鉛の回収の用に供する焙焼炉等		1	10	④アルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉等		1	5	⑤廃棄物焼却炉	焼却能力	4,000kg/時間～	0.1	1	2,000～4,000kg/時間	1	5	～2,000kg/時間	5	10																																																	
規制対象物質 ダイオキシン類		基準値 [単位: ng-TEQ/m ³ N]																																																																																			
特定施設の種類の																																																																																					
①焼結鈳の製造の用に供する焼結炉		新設施設	既存施設																																																																																		
②製鋼の用に供する電気炉		0.5	5																																																																																		
③亜鉛の回収の用に供する焙焼炉等		1	10																																																																																		
④アルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉等		1	5																																																																																		
⑤廃棄物焼却炉	焼却能力	4,000kg/時間～	0.1	1																																																																																	
		2,000～4,000kg/時間	1	5																																																																																	
		～2,000kg/時間	5	10																																																																																	
水質排出基準	<p>第8条 (対象) 法に基づく水質基準適用施設 (19種類) を設置する工場又は事業場 (規制対象物質及び基準値(排水口))</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">規制対象物質 ダイオキシン類</td> <td colspan="2">基準値 [単位: pg-TEQ/l]</td> </tr> <tr> <td colspan="2">特 定 施 設</td> <td colspan="2">新設、既設施設</td> </tr> <tr> <td colspan="2">①硫酸塩パルプ等の製造の用に供する塩素等による漂白施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">②カーバイド法アセチレンの製造用のアセチレン洗浄施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">③硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">④アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑤担体付き触媒の製造 (塩素等を使用するものに限る) に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑥塩化ビニルモノマー製造用の二塩化エチレン洗浄施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑦カプロラクタムの製造 (塩化ニトロシルを使用するものに限る) の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑧クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設、廃ガス洗浄施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑨4-クロロフル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑩2,3-ジクロロ-1,4-ナフキンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑪8・18-ジクロロ-5・15-ジフル-5・15-ジヒドロイソト(3・2-b・3'・2'-m)トリアジナジジン (別名ジキサジンバイオレット) 製造用施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設、熱風乾燥施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑫アルミニウム合金等の製造用の焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設又は湿式集じん施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑬亜鉛の回収 (製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る) 用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑭担体付き触媒 (使用済みのもの) からの金属の回収 (ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法 (焙焼炉で処理しないもの) によるものを除く) の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑮廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び当該廃棄物焼却炉において生ずるの灰の貯留施設で汚水又は廃液を排出するもの</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑯廃棄物処理法施行令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑰フロン類の破壊 (プラズマを用いて破壊する方法等) の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑱①から⑰及び⑲の施設に係る汚水等を処理する下水道終末処理施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑲①から⑰の施設を設置する工場等から排出される水の処理施設</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	規制対象物質 ダイオキシン類		基準値 [単位: pg-TEQ/l]		特 定 施 設		新設、既設施設		①硫酸塩パルプ等の製造の用に供する塩素等による漂白施設				②カーバイド法アセチレンの製造用のアセチレン洗浄施設				③硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設				④アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設				⑤担体付き触媒の製造 (塩素等を使用するものに限る) に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設				⑥塩化ビニルモノマー製造用の二塩化エチレン洗浄施設				⑦カプロラクタムの製造 (塩化ニトロシルを使用するものに限る) の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設				⑧クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設、廃ガス洗浄施設				⑨4-クロロフル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設				⑩2,3-ジクロロ-1,4-ナフキンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設				⑪8・18-ジクロロ-5・15-ジフル-5・15-ジヒドロイソト(3・2-b・3'・2'-m)トリアジナジジン (別名ジキサジンバイオレット) 製造用施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設、熱風乾燥施設				⑫アルミニウム合金等の製造用の焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設又は湿式集じん施設				⑬亜鉛の回収 (製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る) 用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設				⑭担体付き触媒 (使用済みのもの) からの金属の回収 (ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法 (焙焼炉で処理しないもの) によるものを除く) の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設				⑮廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び当該廃棄物焼却炉において生ずるの灰の貯留施設で汚水又は廃液を排出するもの				⑯廃棄物処理法施行令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設				⑰フロン類の破壊 (プラズマを用いて破壊する方法等) の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設				⑱①から⑰及び⑲の施設に係る汚水等を処理する下水道終末処理施設				⑲①から⑰の施設を設置する工場等から排出される水の処理施設			
規制対象物質 ダイオキシン類		基準値 [単位: pg-TEQ/l]																																																																																			
特 定 施 設		新設、既設施設																																																																																			
①硫酸塩パルプ等の製造の用に供する塩素等による漂白施設																																																																																					
②カーバイド法アセチレンの製造用のアセチレン洗浄施設																																																																																					
③硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設																																																																																					
④アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設																																																																																					
⑤担体付き触媒の製造 (塩素等を使用するものに限る) に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設																																																																																					
⑥塩化ビニルモノマー製造用の二塩化エチレン洗浄施設																																																																																					
⑦カプロラクタムの製造 (塩化ニトロシルを使用するものに限る) の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設																																																																																					
⑧クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設、廃ガス洗浄施設																																																																																					
⑨4-クロロフル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設																																																																																					
⑩2,3-ジクロロ-1,4-ナフキンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設																																																																																					
⑪8・18-ジクロロ-5・15-ジフル-5・15-ジヒドロイソト(3・2-b・3'・2'-m)トリアジナジジン (別名ジキサジンバイオレット) 製造用施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設、熱風乾燥施設																																																																																					
⑫アルミニウム合金等の製造用の焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設又は湿式集じん施設																																																																																					
⑬亜鉛の回収 (製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る) 用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																																																																																					
⑭担体付き触媒 (使用済みのもの) からの金属の回収 (ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法 (焙焼炉で処理しないもの) によるものを除く) の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設																																																																																					
⑮廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び当該廃棄物焼却炉において生ずるの灰の貯留施設で汚水又は廃液を排出するもの																																																																																					
⑯廃棄物処理法施行令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設																																																																																					
⑰フロン類の破壊 (プラズマを用いて破壊する方法等) の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																																																																																					
⑱①から⑰及び⑲の施設に係る汚水等を処理する下水道終末処理施設																																																																																					
⑲①から⑰の施設を設置する工場等から排出される水の処理施設																																																																																					
廃棄物焼却炉のばいじん、焼却灰等、燃え殻の処理	<p>第24条 (対象) 法に基づく大気基準適用施設のうち廃棄物焼却炉 (規制対象物質及び基準値) 規制対象物質 ダイオキシン類 基準値 3ng-TEQ/g</p>																																																																																				
廃棄物の最終処分場の維持管理	<p>第25条 (対象) 廃棄物処理法に基づく一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場 (管理型) (規制対象物質及び基準値) 規制対象物質 ダイオキシン類 放流水の水質基準値 10pg-TEQ/l</p>																																																																																				